

**DEMANDE DE SOUTIEN PAR LA PLATEFORME RENATECH
DU LAAS****Le : 26 Septembre 2012****TITRE DU PROJET****Utilisation de moyens de microscopie électronique à balayage et de système de faisceau
d'ions focalisé dans le cadre d'analyses de défaillance et de construction des composants
microélectroniques****DEMANDEUR****Nom et qualité : Mr LOHIER****Organisme : HIREX Engineering****Tutelle :****Institut :****Discipline scientifique :**

Sciences biologiques	Chimie	Ecologie et environnement	Sciences de l'ingénierie	Physique	Sciences de l'univers	Physique Nucléaire
			X	X		

Adresse : **2, rue des satellites 31520 Ramonville Saint Agne**
N° de téléphone : **05 62 47 56 90**
N° de fax : **05 62 47 56 95**
Email : **d.lohier@hirex.fr**

Contact au LAAS (éventuellement) : Mr Benjamin REIG

1/5

**DEMANDE DE SOUTIEN PAR LA PLATEFORME RENATECH
DU LAAS****CONTEXTE SCIENTIFIQUE DU PROJET (5 A 10 LIGNES MAX)**

Apport de la gravure et de l'imagerie ionique dans le cadre d'analyses des technologies submicroniques.

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES DU PROJET (5 A 10 LIGNES MAX)

Développement de méthodes de localisation et de caractérisation physique.

Début souhaité des travaux : **26/09/2012**

Durée estimée du projet : **12 mois**

Cadre institutionnel du projet : projets ANR, conseil régional, Europe, autres, ...

PERSONNE ACCUEILLIE AU LAAS-CNRS LE CAS ECHEANT

Nom et qualité : Mr Jean-Michel MORIN

Organisme : HIREX Engineering

Adresse : **2, rue des Satellites 31520 Ramonville Saint Agne**
N° de téléphone : **05 62 47 56 90**
N° de fax : **05 62 47 56 95**
Email : **jm.morin@hirex.fr**

Evaluation des connaissances de la technologie nécessaires à la réalisation prévue :

Théoriques : 8/10

Pratiques : 9/10

2/5

DEMANDE DE SOUTIEN PAR LA PLATEFORME RENATECH DU LAAS

Commentaires : Personne déjà formée sur ce type d'équipement ayant 5 ans de pratique en zone de fabrication chez Freescale semiconducteurs.

NATURE DES TRAVAUX

NATURE DU PROJET						
(Un projet peut couvrir plusieurs thématiques préciser un ordre de priorité)						
Micro et nano électronique	Spintronique	Photonique	Micro mécatronique	Simulation	Instrumentation	Autres
X	NC	NC	NC	NC	NC	

PROCEDES

Description des étapes du(es) procédé(s) dans l'ordre prévisible

RESSOURCES SOLLICITEES	<input type="checkbox"/> Lithographie laser (fabrication de masque)	<input type="checkbox"/> EJM
	<input type="checkbox"/> Photolithographie UV	<input type="checkbox"/> Implantation ionique
	<input type="checkbox"/> Lithographie électronique	<input type="checkbox"/> Fours
	<input checked="" type="checkbox"/> Chimie	<input type="checkbox"/> Nano imprint
	<input type="checkbox"/> Electrochimie	<input type="checkbox"/> Jet d'encre
	<input type="checkbox"/> Dépôts PVD	<input type="checkbox"/> Assemblage
	<input type="checkbox"/> Gravure plasma	<input type="checkbox"/> Séchage supercritique
	<input type="checkbox"/> Gravure humide (KOH/TMAH)	<input checked="" type="checkbox"/> Caractérisation

VERROUS IDENTIFIES

Etapes nécessitant un développement technologique, ou l'adaptation d'un équipement, ou tributaires de ressources fournies par un partenaire

VOLUME

3/5

**DEMANDE DE SOUTIEN PAR LA PLATEFORME RENATECH
DU LAAS**

Nombre de plaques à traiter et nombre de runs.
--

REUSSITE ESCOMPTEE

Le demandeur est pleinement conscient que le LAAS-CNRS est tenu par une obligation de moyens et non par une obligation de résultat.

Il est possible que l'ensemble des objectifs du projet ne puisse pas être couvert, ou ne soit pas couvert dans le temps prévu. Au terme de ce délai, on peut, en interaction entre le demandeur et la centrale de technologie, arrêter le projet ou redéfinir un mode de collaboration (identique ou différent).

Donnez, en quelques lignes, votre vision de la réussite escomptée :

Si la demande de réalisation est susceptible d'être renouvelée au cours de développements ultérieurs du projet, donnez une estimation du cycle :

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Les résultats obtenus dans le cadre du présent Projet sont la propriété de l'Organisme dont relève le Demandeur.

L'Organisme dont relève le Demandeur concède au LAAS, un droit d'utilisation pour ses besoins propres de recherche et exclut toute utilisation, même gratuite, à caractère commercial.

Les savoir-faire et connaissances mis en oeuvre par le LAAS pour réaliser le Projet restent la propriété du CNRS ; en conséquence, toute amélioration du savoir-faire demeurera la propriété du CNRS.

AUTRES REMARQUES

4/5

**DEMANDE DE SOUTIEN PAR LA PLATEFORME RENATECH
DU LAAS**

DEMANDE ADRESSEE A D'AUTRES CENTRALES RTB :
(SI OUI PRECISER LAQUELLE)

5/5



RENAMECH

LAAS-CNRS, plateforme RENAMECH
7 avenue du Colonel Roche 31077 TOULOUSE
Tél : 05.61.33.79.46 Fax : 05.61.33.62.08
Mail : plateformertb@laas.fr